

IR 乾燥炉

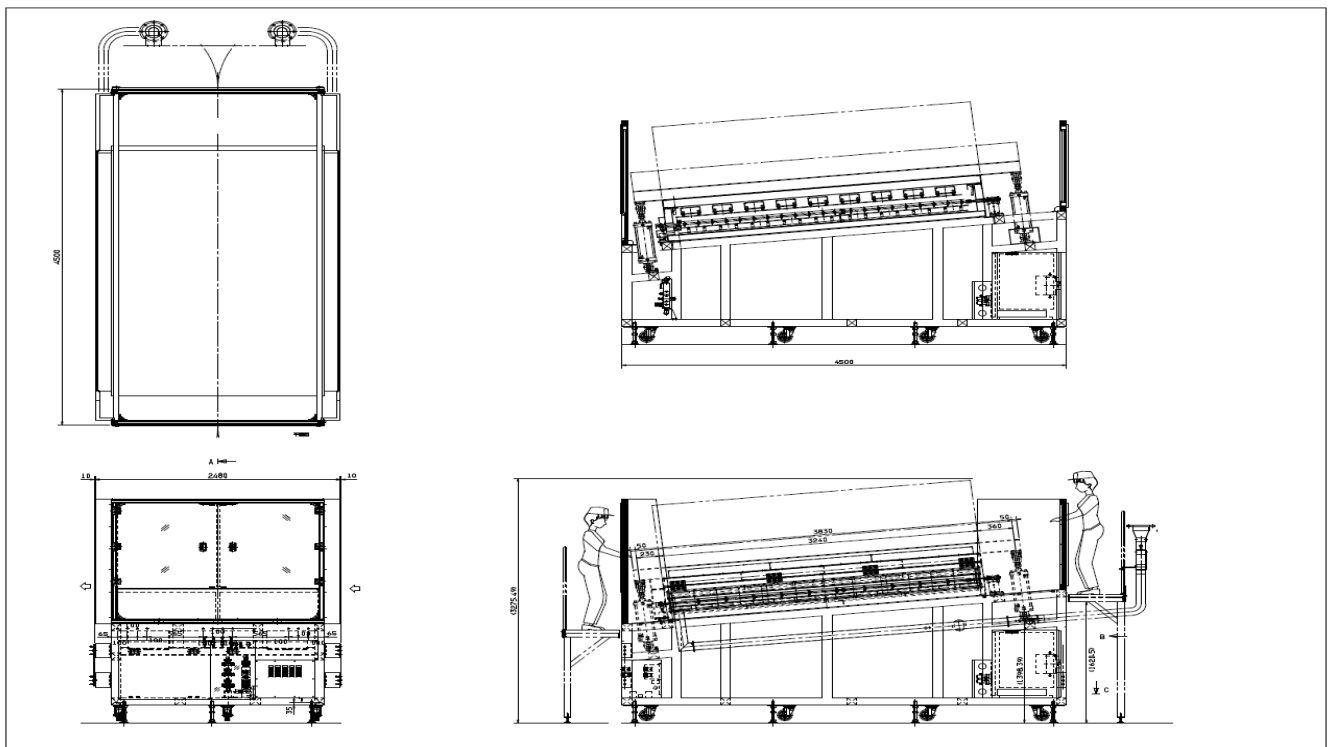
<概要>

本装置は洗浄、エアブロー後の基板を加熱することにより、基板上の微水分を蒸発させ、乾燥を行うものです。
ガラス基板をクリーン遠赤外線ヒーター（クラス100）で加熱乾燥します。

<主な仕様>

1. 被加熱物 : TFT用ガラスパネル (2880×3130×0.6 t)
2. 処理方法 : ローラー搬送によるタクト搬送 (6° 傾斜)
3. 処理速度 : 75mm/s (Tact Time : 56sec)
4. 加熱条件 : ガラス表面温度 70℃以上到達
5. パスライン : FL+1800±25mm

<外観図 (イメージ)>

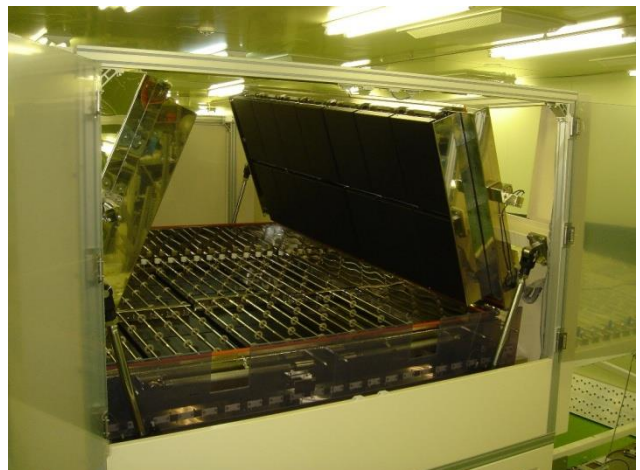


(2500W×4500D×3000H)

<写真>



外観



炉内部